

T F T液晶ディスプレイ製造工程において、エッチングガスとして用いられているSF₆(温暖化係数:23,900)の代替ガスとしてCOF₂(温暖化係数:1)を導入することで、温室効果ガス排出量を大幅に削減します。

プロジェクトの実施場所	高知県南国市久礼田2420
削減量(予測)	年間 1,265 t-CO ₂
在庫量	0 t-CO ₂ (2012年6月時点)
クレジットの次回発行予定	2013年4月
1t-CO ₂ あたりの希望単価	検討中

オルタステクノロジー高知は地球温暖化抑制に向け日々たゆまぬ努力を続けています。温室効果ガスの代替化においてクリーニングガス(NF₃)の全量代替化(2005年)に続き、エッチングガスであるSF₆の代替化を推進しています。

このプロジェクトにより、世界のT F T液晶ディスプレイ製造工場や半導体製造工場の温室効果ガス代替化が加速され、地球温暖化抑制に貢献する事を期待しています。

加工用ガスの代替により、年間最大1,265トン相当のCO₂削減に貢献



SF₆
GWP=23,900

➔



COF₂
GWP=1

GWP: Global Warming Potential (地球温暖化係数)



SF₆ガスからCOF₂ガスに変更されたドライエッチング装置